

06.1; 06.2

(C) 1991

ДЕГРАДАЦИЯ БАРЬЕРОВ ШОТТКИ НА КРЕМНИИ,  
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПЕРЕСТРОЙКОЙ  
ГЛУБОКИХ ПРИМЕСНЫХ ЦЕНТРОВ

К.А. А д и л о в, Ф.С. Ш а х а б и д д и н о в

Экспериментальное обнаружение протекания процессов перестройки дефектов – так называемых рекомбинационно-стимулированных процессов (РСП) в светодиодах и инжекционных лазерах, столь явно связанных с деградацией этих приборов [1], сделало остроактуальной задачу их изучения для полупроводниковой электроники. С другой стороны, физические механизмы и модели перестройки дефектов – возникновение новых структурных и антиструктурных центров, ассоциация и диссоциация примесей, в том числе глубоких примесных центров (ГПЦ) и т.д. стали привлекательным объектом для разносторонних фундаментальных исследований. Особый интерес представляют такие исследования на основном материале современной микроэлектроники – на кремнии. Это обусловило цель данной работы – изучение физических механизмов РСП в фотоприемниках ИК-диапазона на основе барьеров Шоттки из р-*Si*, легированного *Se*, *Te*, *Zn* и *Cr*.

В качестве исходного материала для изготовления барьеров Шоттки использованы кристаллы р-*Si* марки КДБ с концентрацией неконтролируемых примесей кислорода и углерода  $N_{O,C} < 10^{17} \text{ см}^{-3}$ . Величина исходной концентрации мелких акцепторов бора в р-*Si* составляла  $N_B = 5 \cdot 10^{14} - 10^{16} \text{ см}^{-3}$ . Легирование р-*Si* примесными атомами *Se*, *Te*, *Zn* и *Cr*, а также изготовление барьеров Шоттки осуществлены по методике [2]. Качественные изменения фоточувствительности образцов контролировались исследованием спектров фотопроводимости, а количественный анализ – снятием спектров *DLTS* [3] до и после инжекции путем приложения обратного смещения  $\sim 5-50$  В в течение 5–30 мин при 250–350 К.

На рис. 1 представлены зависимости изменения фоточувствительности ( $I_\phi$ ) образцов от плотности инжектированных электронов ( $J$ ). Видно, что, начиная с  $J \geq 3 \cdot 10^3 \text{ A} \cdot \text{с} / \text{см}^2$ , величина  $I_\phi$  при освещении образцов светом из области собственного поглощения резко уменьшается, и при  $J \approx 9 \cdot 10^3 \text{ A} \cdot \text{с} / \text{см}^2$  кривые  $I_\phi \sim f(J)$  достигают насыщения, т.е. образцы деградируют.

Природа деградации фоточувствительности была выяснена снятием спектров *DLTS* (рис. 2). Как видно, в исходном состоянии (кривые 1) наблюдались ГПЦ с энергиями ионизации  $E_1 = E_\sigma + 0.2$  эВ (*Si* : *Se*),  $E_2 = E_\sigma + 0.24$  (*Si* : *Te*),  $E_3 = E_\sigma + 0.13$  (*Si* : *Zn*) и  $E_4 = E_\sigma + 0.28$  (*Si* : *Cr*), которые обуславливают

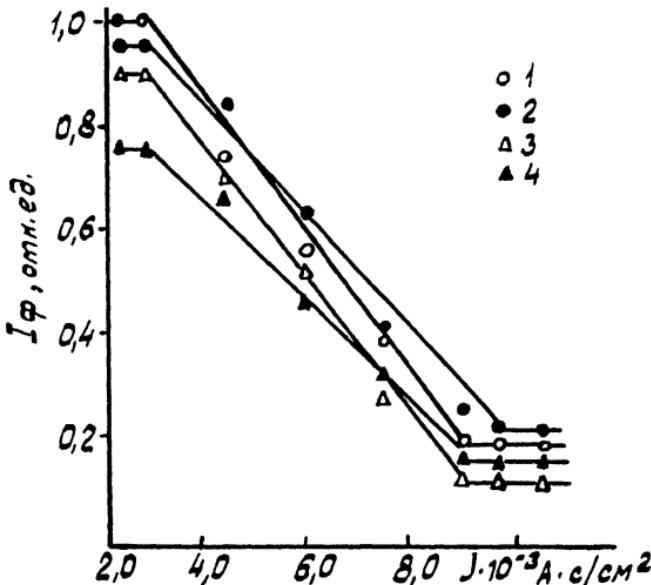


Рис. 1. Зависимости изменения фоточувствительности образцов от плотности инжектированных электронов при 250 К: 1 -  $Si : Se$ , 2 -  $Si : Te$ , 3 -  $Si : Zn$ , 4 -  $Si : Cr$ . Обратное смещение 20 В.

фоточувствительность исследованных образцов. При этом величина концентраций всех ПЦ ( $N_{\text{ПЦ}}$ ) сильно зависят от величины  $N_B$  (кривые 2-4), т.е. с увеличением  $N_B$  значения  $N_{\text{ПЦ}}$  возрастают и наоборот. В работе [2] показано, что это объясняется захватом большей части подвижных междуузельных атомов  $Se_i^+$ ,  $Te_i^+$ ,  $Zn_i^+$  и  $Cr_i^+$  в процессе легирования р- $Si$  и быстрого после-диффузионного охлаждения легированных кристаллов узловыми атомами бора ( $B_s^-$ ). При этом образуются донорно-акцепторные пары (ДАП)  $SeB^0$  [4, 5],  $TeB^0$  [4, 6],  $ZnB^0$  [2, 7] и  $CrB^0$  [8-10], реакция связи которых осуществляется кулоновским притяжением между положительно заряженными атомами  $Se_i^+$ ,  $Te_i^+$ ,  $Zn_i^+$  и  $Cr_i^+$  (доноры  $D_i^+$ ) и отрицательно заряженным акцептором  $B_s^-$  (реакция идет вправо):



Равновесную атомную часть донорного компонента, спаренного с  $B_s^-$  при данной температуре можно определить из соотношения [2]:

$$[D_i^+] \approx 5 \cdot 10^{-24} [B_s^-] \exp(\epsilon_c/kT), \quad (2)$$

где  $\epsilon_c$  - энергия связи (спаривания) ДАП. Измерения при  $T < 300$  К показали, что при  $[B_s^-] > 10^{14} \text{ см}^{-3}$  почти все атомы  $D_i^+$  находятся в равновесном состоянии как  $(D_i^+ B_s^-)^0$  и для

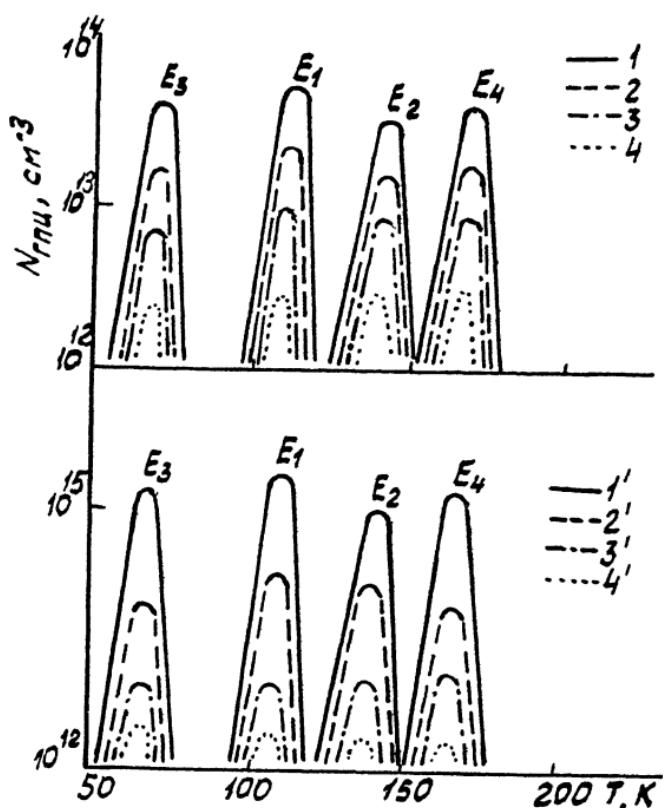


Рис. 2. Спектры  $DLTS$  до (1-4) и после ( $1'-4'$ ) инжекции электронов с  $J = 6 \cdot 10^3$  А  $\text{с} / \text{см}^2$  при 250 К. Обратное смещение 20 В.

$$1 - N_B = 10^{16} \text{ см}^{-3}, 2 - 5 \cdot 10^{15}, 3 - 10^{15}, 4 - 5 \cdot 10^{14}.$$

спаренных частей  $Se_i$ ,  $Te_i$ ,  $Zn_i$  и  $Cr_i$  определены следующие эмпирические температурные зависимости:

$$\frac{(Se_i B_S)}{(Se_i)(B_S)} = 10^{-23} \cdot \exp \left[ \frac{0.68 \pm 0.02 \text{ эВ}}{kT} \right],$$

$$\frac{(Te_i B_S)}{(Te_i)(B_S)} = 10^{-23} \cdot \exp \left[ \frac{0.86 \pm 0.02 \text{ эВ}}{kT} \right],$$

$$\frac{(Zn_i B_S)}{(Zn_i)(B_S)} = 10^{-23} \cdot \exp \left[ \frac{0.64 \pm 0.02 \text{ эВ}}{kT} \right],$$

$$\frac{(Cr_i B_S)}{(Cr_i)(B_S)} = 10^{-23} \cdot \exp \left[ \frac{0.65 \pm 0.02 \text{ эВ}}{kT} \right].$$

Величины  $E_c$ , приведенные в (3) определены нами по наклону зависимости  $\ln N_{\text{ГПЦ}} \sim f(10^3/T)$  термического отжига ДАП ( $D_i^+ B_S^-$ ), т.е. ГПЦ  $E_1 - E_4$ .

Ясно, что когда один из компонентов пары ( $B_i^+ B_s^-$ ) станет нейтральным, то реакция спаривания (1) гасится. В материале р-типа такое изменение в зарядовом состоянии ДАП достигается установкой уровня Ферми ниже уровня  $B_s^-$  или же выше уровня  $D_i^+$ . Последний процесс окажется более действенным при приложении обратного смещения к исследованным барьераам Шоттки. Инжекция электронов как бы приковывает уровень Ферми к середине зоны внутри пространственной величины истощенной области. При этом центр  $D_i^+$  будет свободным от дырок или же заряженным нейтрально и ДАП ( $D_i^+ B_s^-$ )<sup>0</sup> распадается по реакции (1) (реакция идет влево). Т.е. после изменения зарядового состояния центра  $D_i^+$  понижается барьер для его миграции, соответствующий  $E_c$ , он становится подвижным и не участвует в процессе параобразования с  $B_s^-$ . В дальнейшем центр  $D_i^+$ , мигрируя по междуузлиям, видимо, коагулирует в нейтральные ассоциаты типа ( $D_i^+$ )<sub>n</sub>. Последнее и обуславливает снижение величин  $N_{\text{ГПЦ}}$ , отсутствие новых ГПЦ после инжекции и, тем самым, уменьшение фоточувствительности (деградацию) исследованных барьеров Шоттки.

#### Список литературы

- [1] Dean P.J., Shoukue W.J. // Adv. Phys. 1977. V. 26. N 1. P. 1-12.
- [2] Адилов К.А. Фотохимическая перестройка глубоких примесных центров в кремнии р-типа: Деп. в ВИНИТИ, № 3699-90 от 28.06.90. М.: ВИНИТИ, 1990. 25 с.
- [3] Lane D.V. // J. Appl. Phys. 1974. V. 45. N 7. P. 3023-3032.
- [4] Адилов К.А. // Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук. 1989. № 2. С. 66-69.
- [5] Адилов К.А., Турсунов Ш.С. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 9. С. 1624-1627.
- [6] Адилов К.А. // Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук. 1989. № 4. С. 63-66.
- [7] Fuller C.S., Morin F.L. // Phys. Rev. 1957. V. 105. N 6. P. 379-383.
- [8] Conzelmann H., Graff K., Weber E.R. // Appl. Phys. A. 1983. V. 30. N 3. P. 169-175.
- [9] Адилов К.А., Турсунов Ш.С. // ДАН УзССР. 1990. № 6. С. 19-20.
- [10] Адилов К.А., Турсунов Ш.С. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. № 14. С. 42-45.

Специализированное конструкторское  
бюро с опытным производством  
Отдела теплофизики АН УзССР,  
Ташкент

Поступило в Редакцию  
13 февраля 1991 г.  
В окончательной редакции  
7 июля 1991 г.